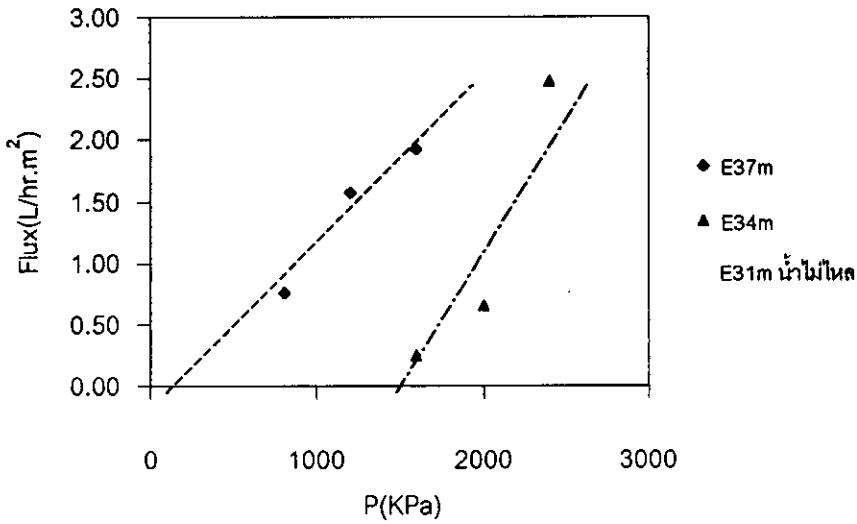


ภาคผนวก ค
อัตราการผลิตของน้ำผ่านแผ่นแมมเบรน

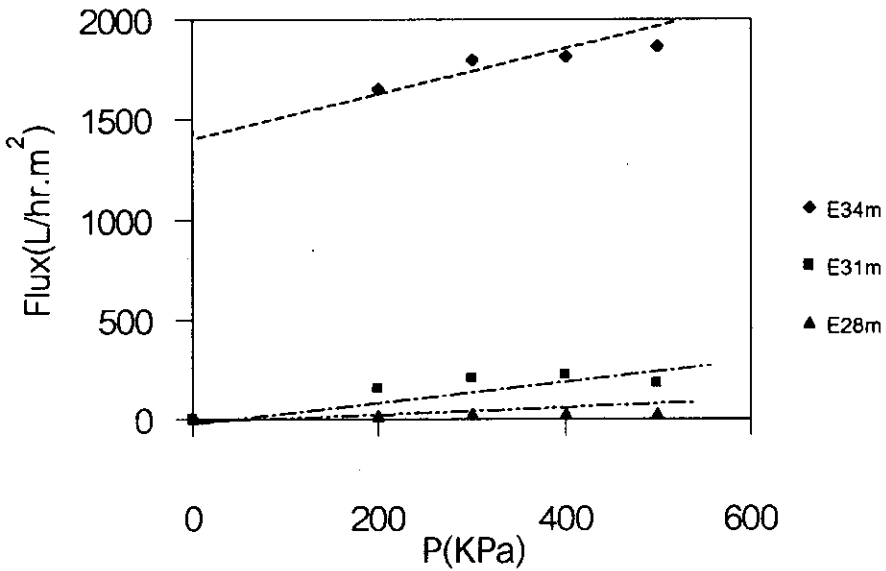
1. อาบนิวตรอน 5 นาที

- ความเข้มข้นของ NaOH 2.25 N

- จุดข้อมูลที่ใช้ในการกักขายรอย 75 °C น้ำไม่ไหล
- จุดข้อมูลที่ใช้ในการกักขายรอย 80 °C

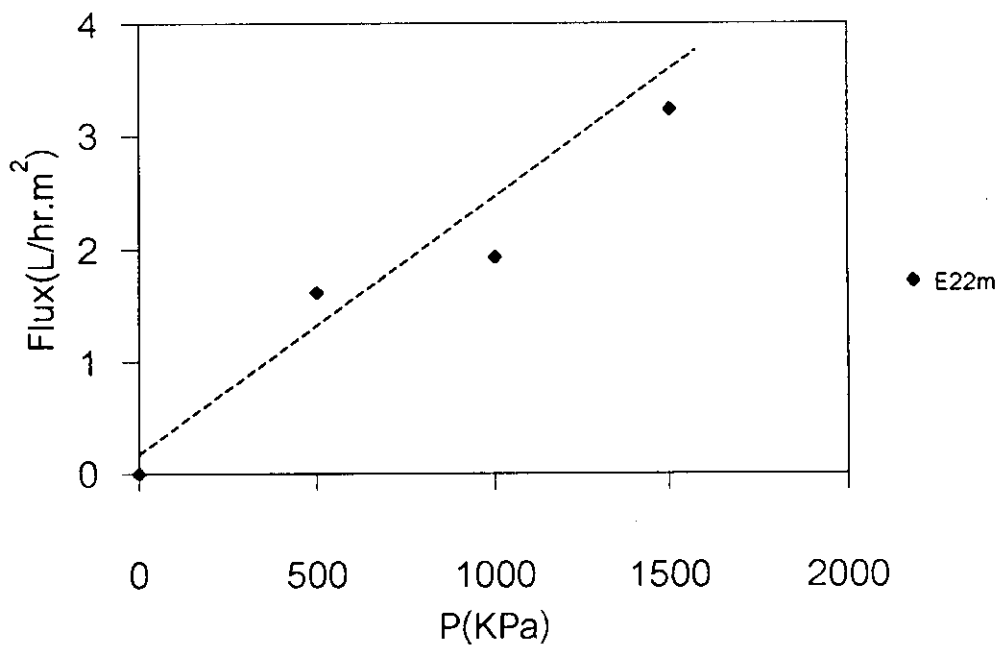


- จุดข้อมูลที่ใช้ในการกักขายรอย 85 °C

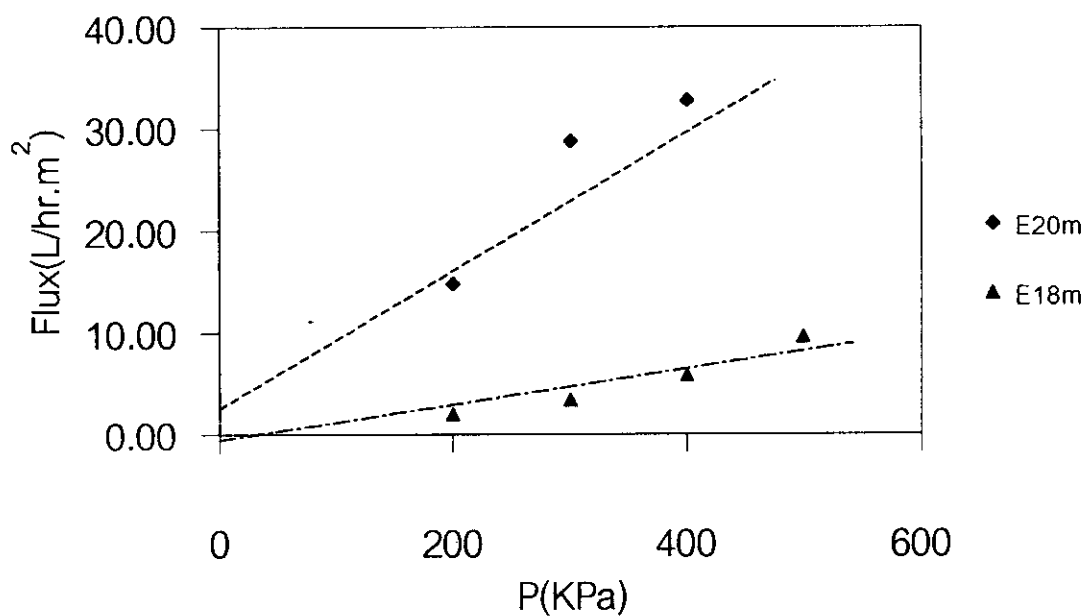


- ความเข้มข้นของ NaOH 4.25 N

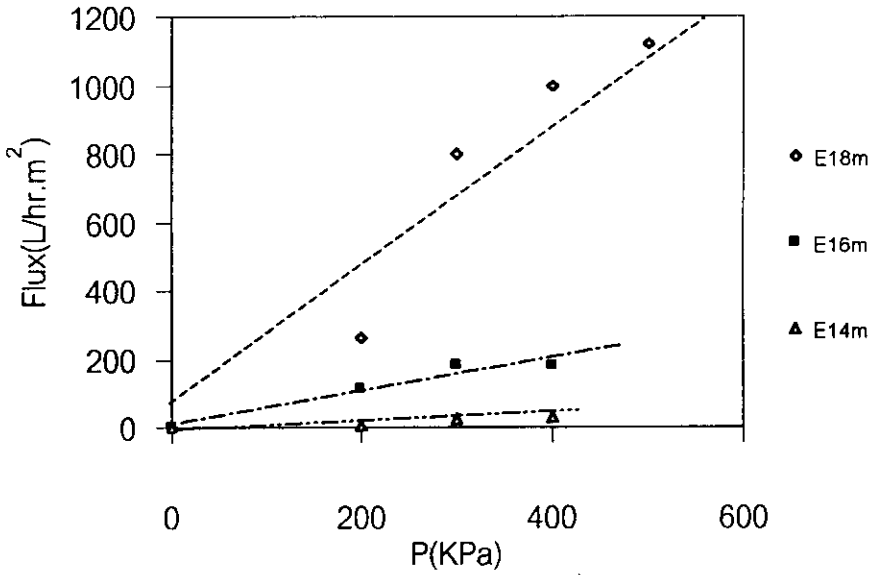
- จุดหนุมิที่ใช้ในการกักขายรอย 75 °C



- จุดหนุมิที่ใช้ในการกักขายรอย 80 °C

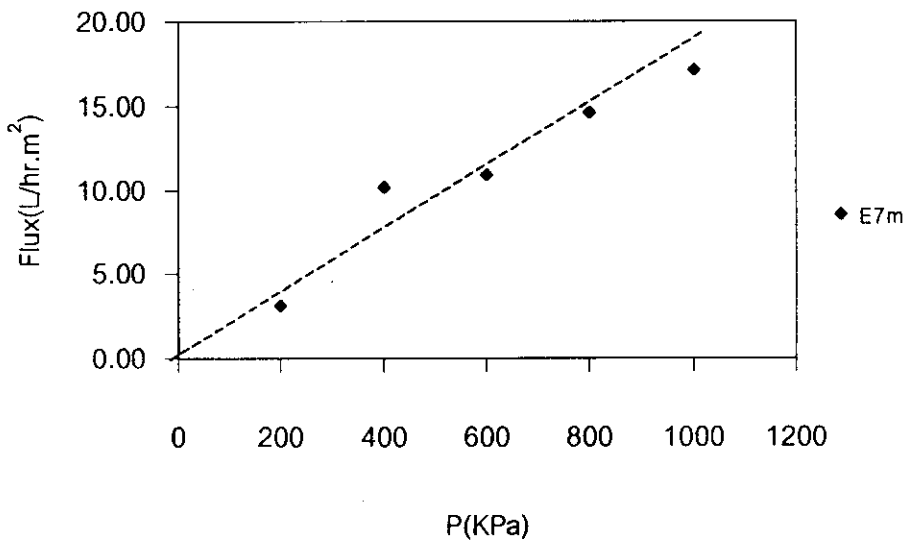


- จุดหมุมที่ใช้ในการกักขายรอย 85 °C



- ความเข้มข้นของ NaOH 6.25 N

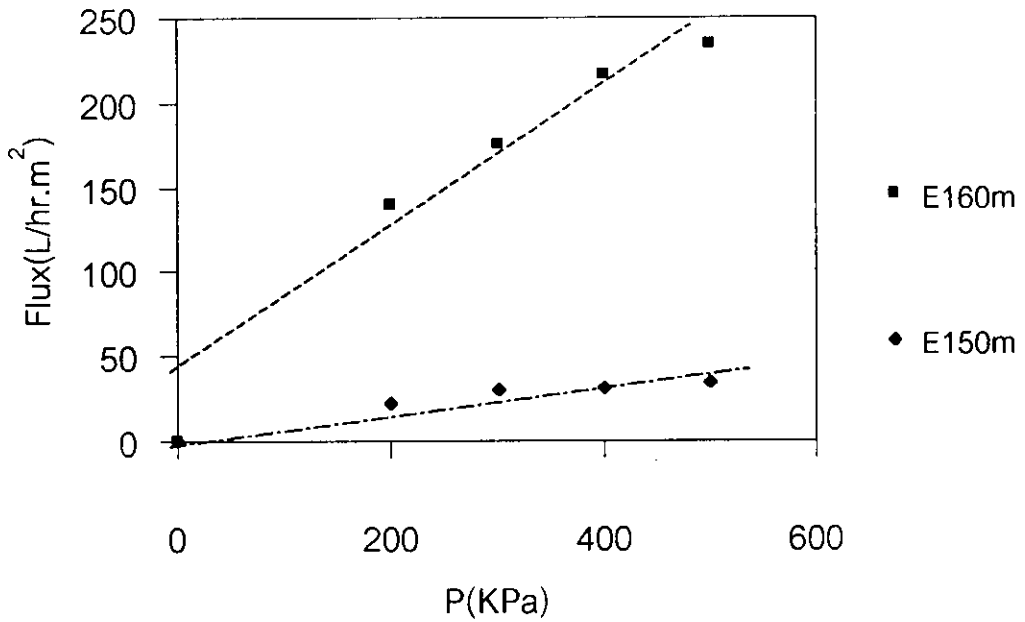
- จุดหมุมที่ใช้ในการกักขายรอย 75 °C น้ำไม่ไหล
- จุดหมุมที่ใช้ในการกักขายรอย 80 °C น้ำไม่ไหล
- จุดหมุมที่ใช้ในการกักขายรอย 85 °C



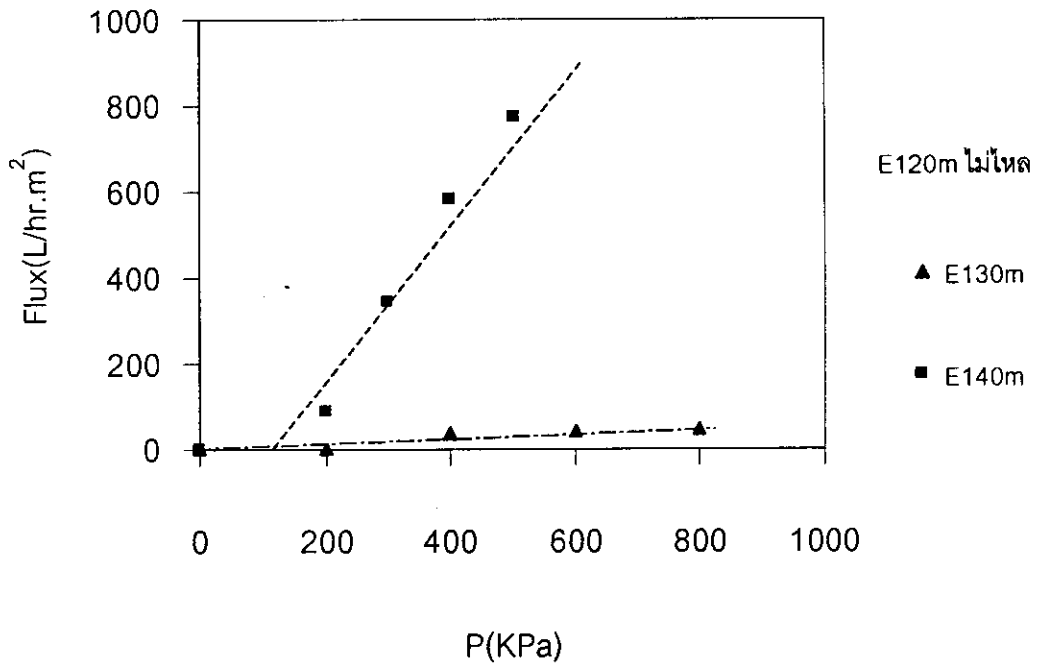
2. อานิวตรอน 10 นาที

- ความเข้มข้นของ NaOH 1.25 N

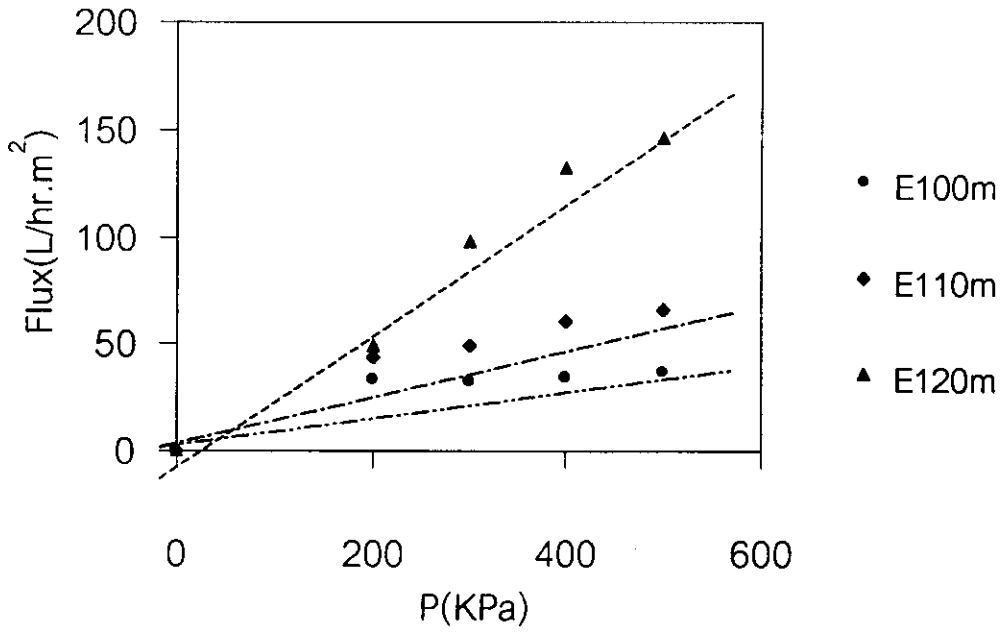
- จุดหมุมที่ใช้ในการกักขายรอย 75 °C



- จุดหมุมที่ใช้ในการกักขายรอย 80 °C

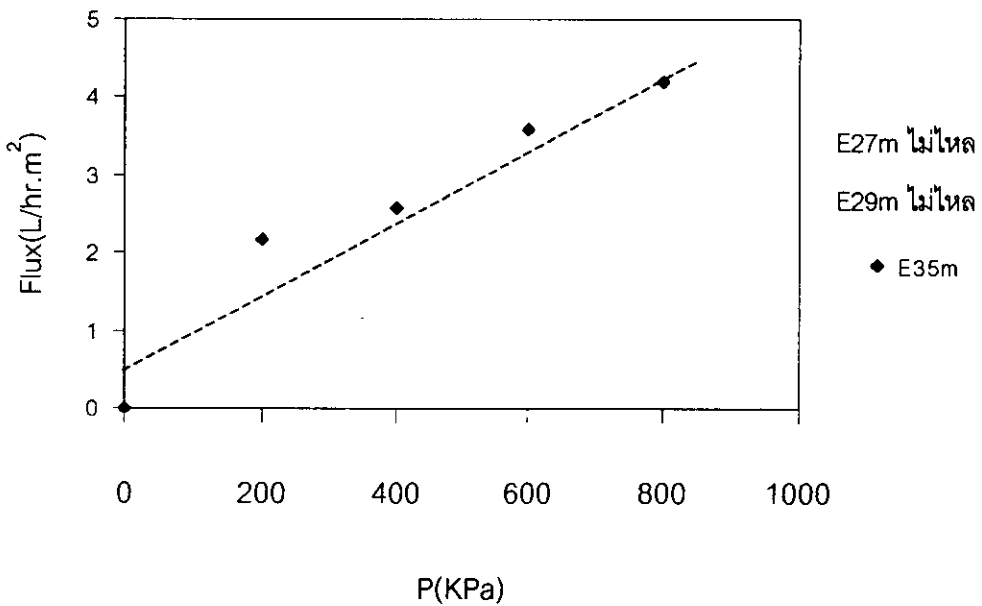


- จุดหมุมิที่ใช้ในการกักตยายรอย 85°C

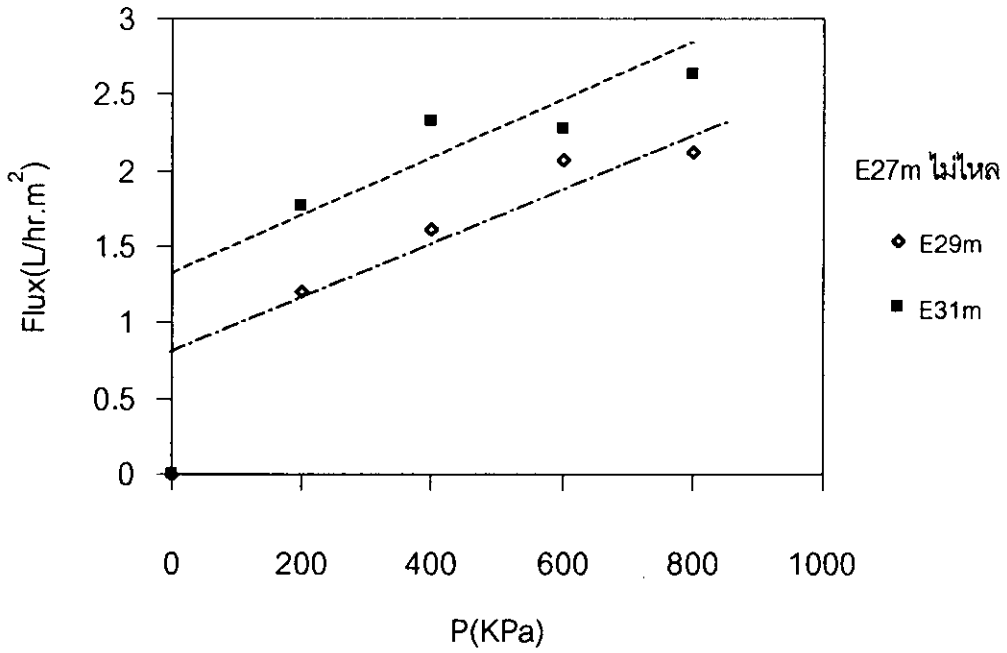


- ความเข้มข้นของ NaOH 2.25 N

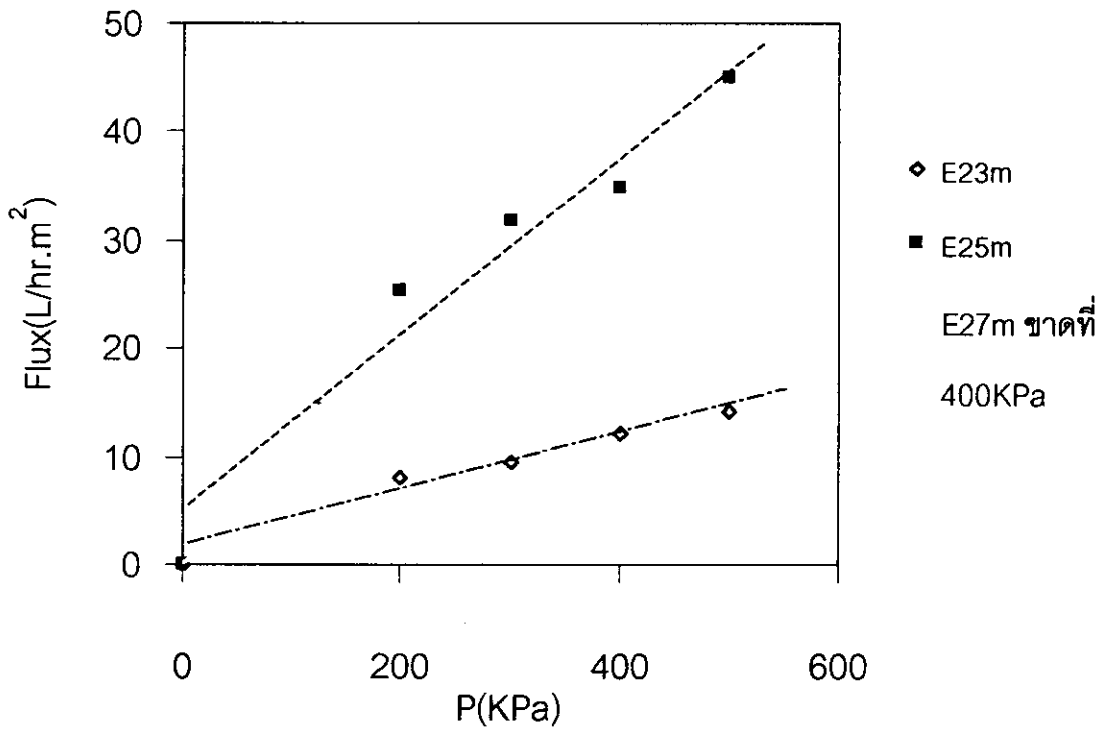
- จุดหมุมิที่ใช้ในการกักตยายรอย 75 °C



● จุดหนุมิที่ใช้ในการกักขายรอย 80 °C

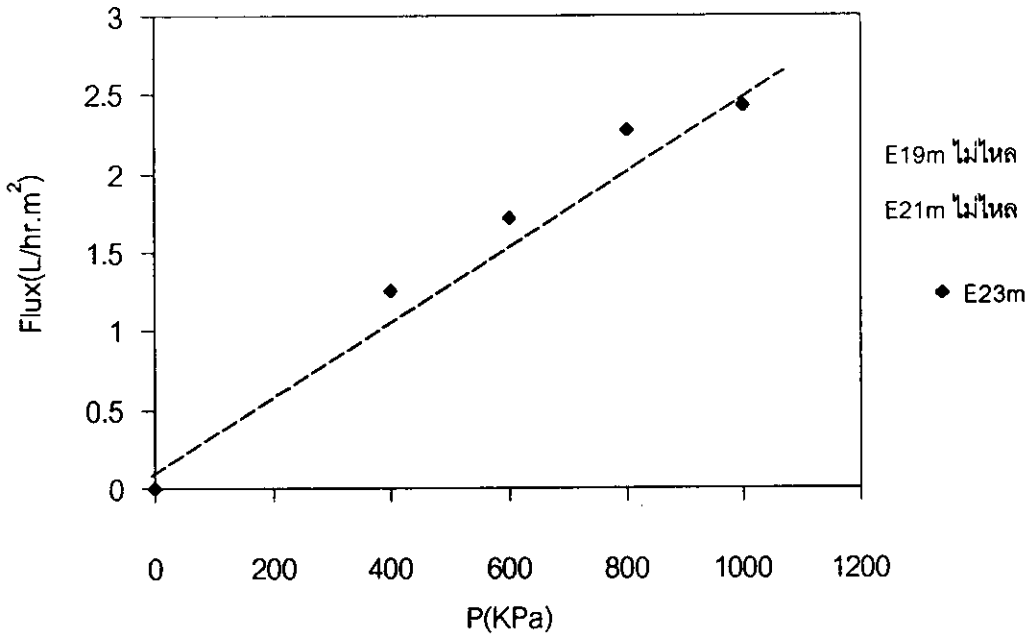


● จุดหนุมิที่ใช้ในการกักขายรอย 85 °C

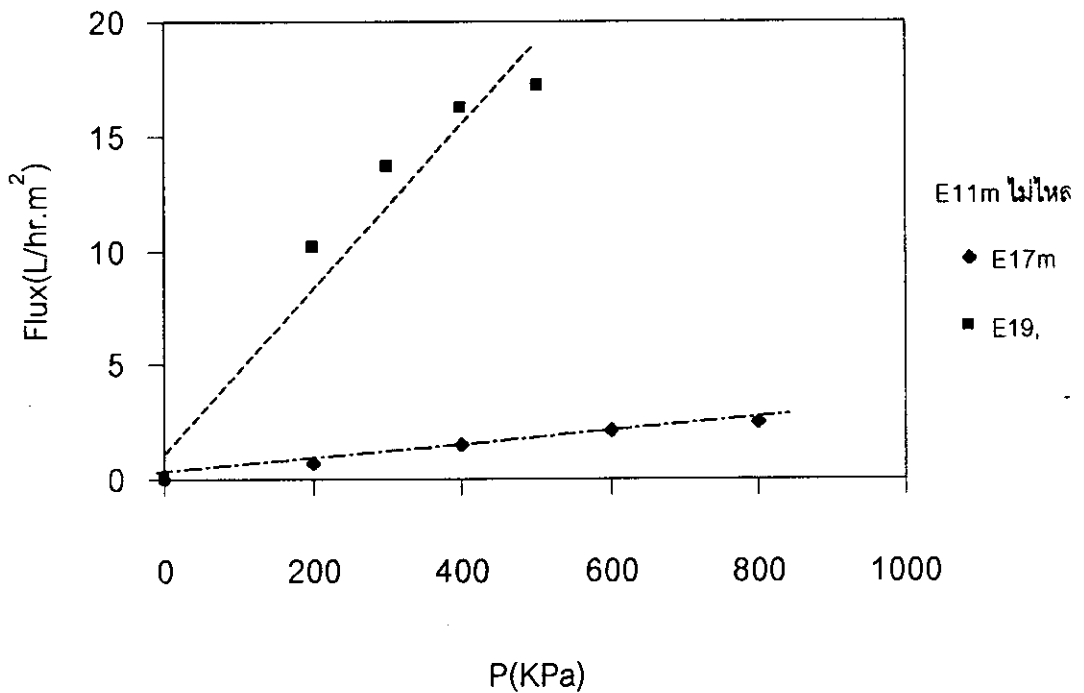


- ความเข้มข้นของ NaOH 3.25 N

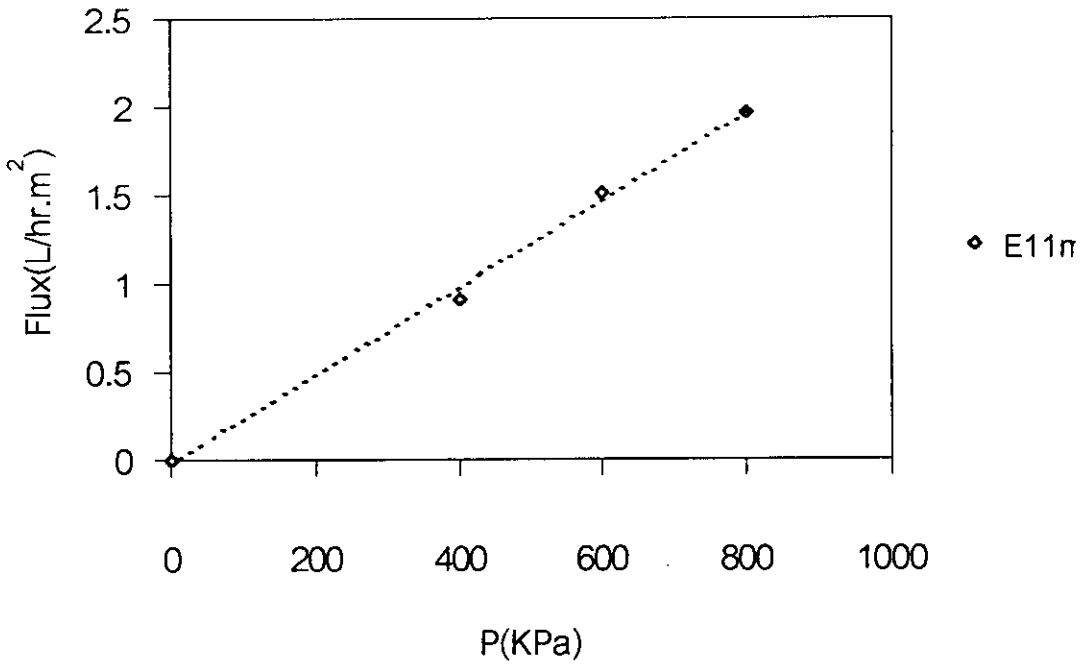
● จุดข้อมูลที่ใช้ในการกัดยายรอย 75 °C



● จุดข้อมูลที่ใช้ในการกัดยายรอย 80 °C



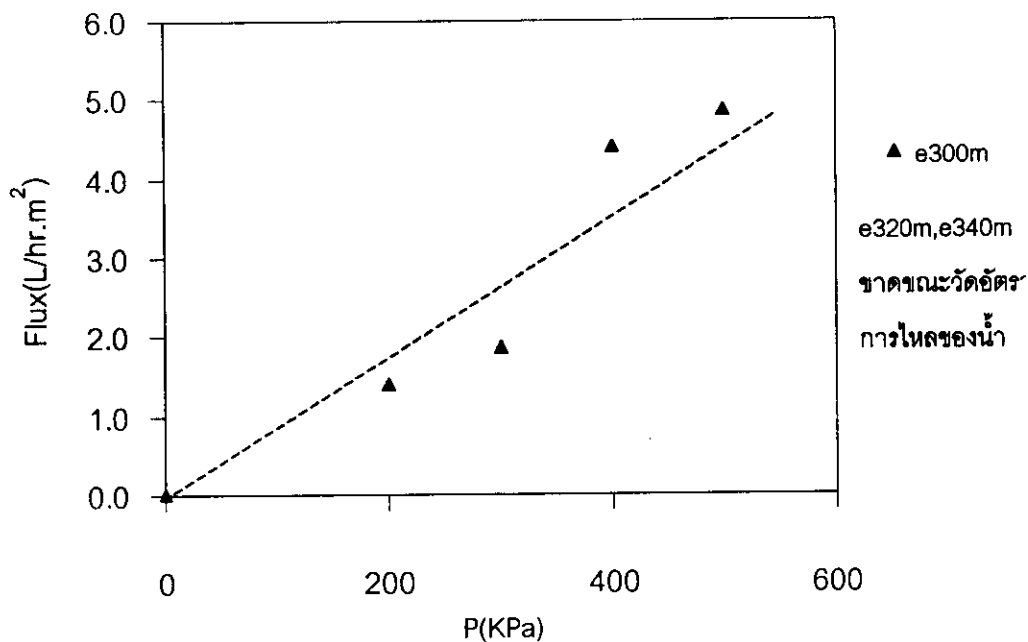
● จุดหนุมิที่ใช้ในการกัตขยายรอย 85 °C



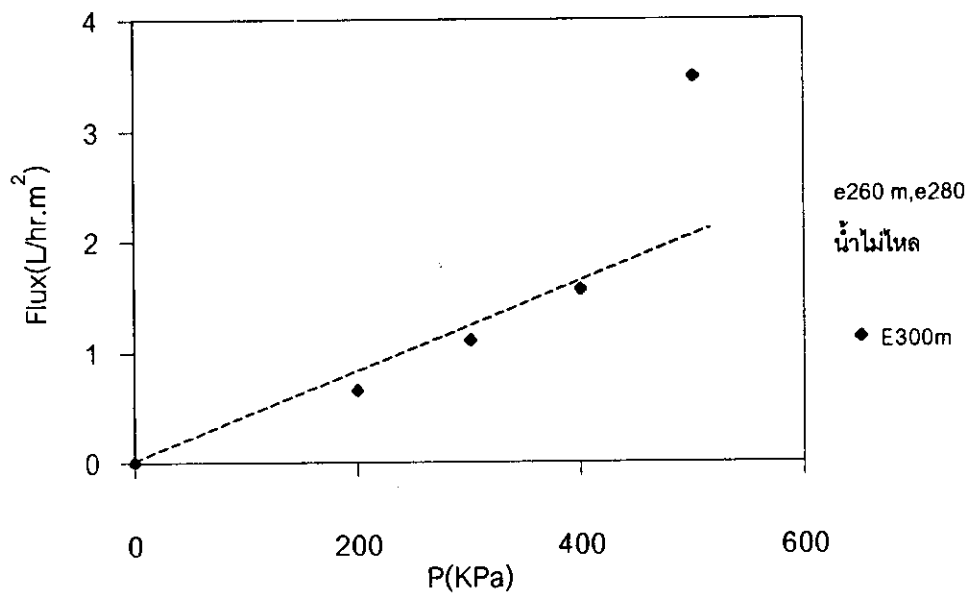
3. อาบนิวตรอน 20 นาที

- ความเข้มข้นของ NaOH 0.75 N

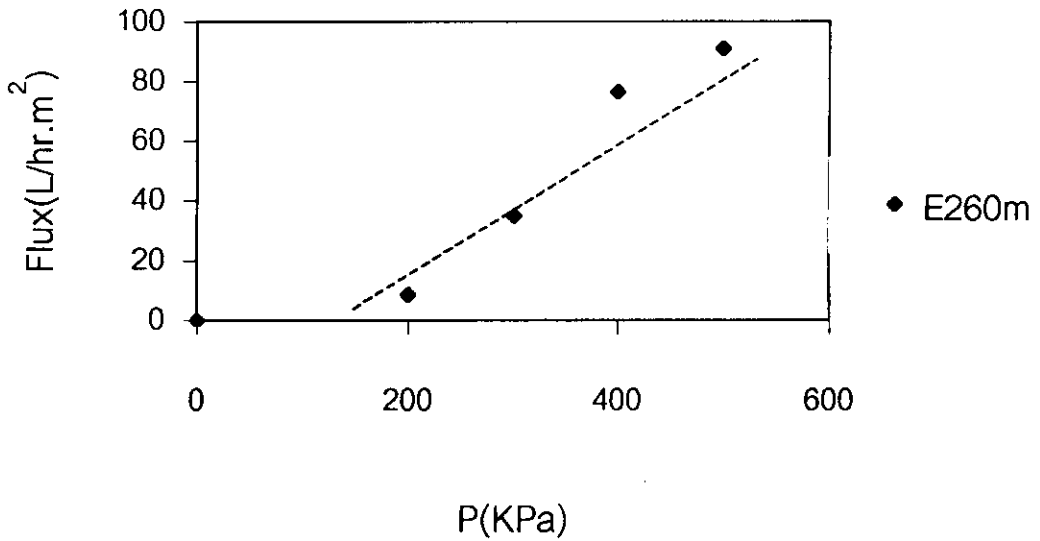
- จุดข้อมูลที่ใช้ในการกักขยายรอย 75 °C



- จุดข้อมูลที่ใช้ในการกักขยายรอย 80 °C

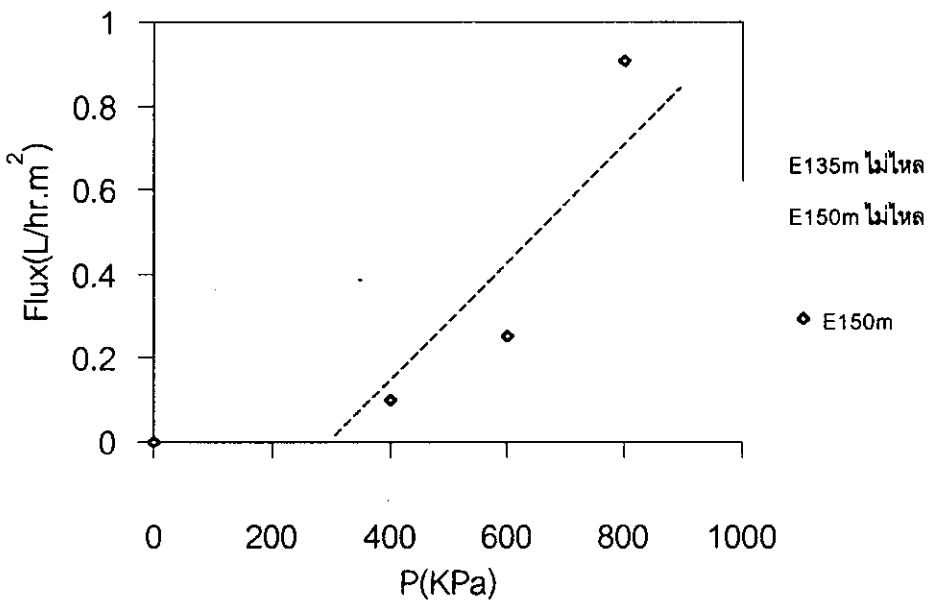


- จุดหมุมที่ใช้ในการกักขายรอย 85 °C

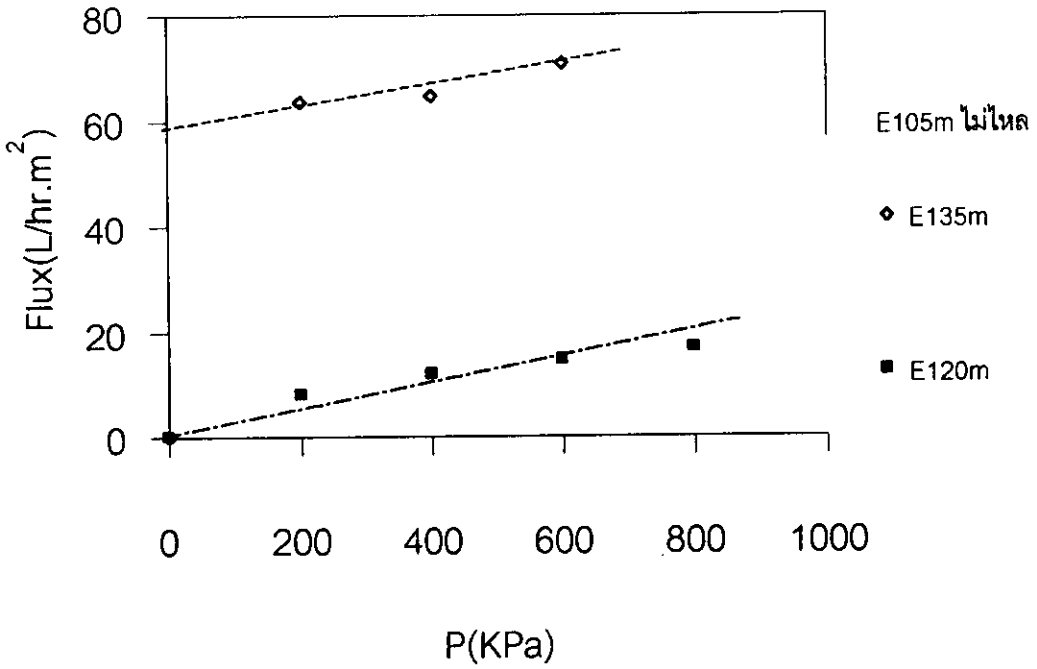


- ความเข้มข้นของ NaOH 1.00 N

- จุดหมุมที่ใช้ในการกักขายรอย 75 °C น้ำไม่ไหลทุกเงื่อนไขการกักขายรอย
- จุดหมุมที่ใช้ในการกักขายรอย 80 °C

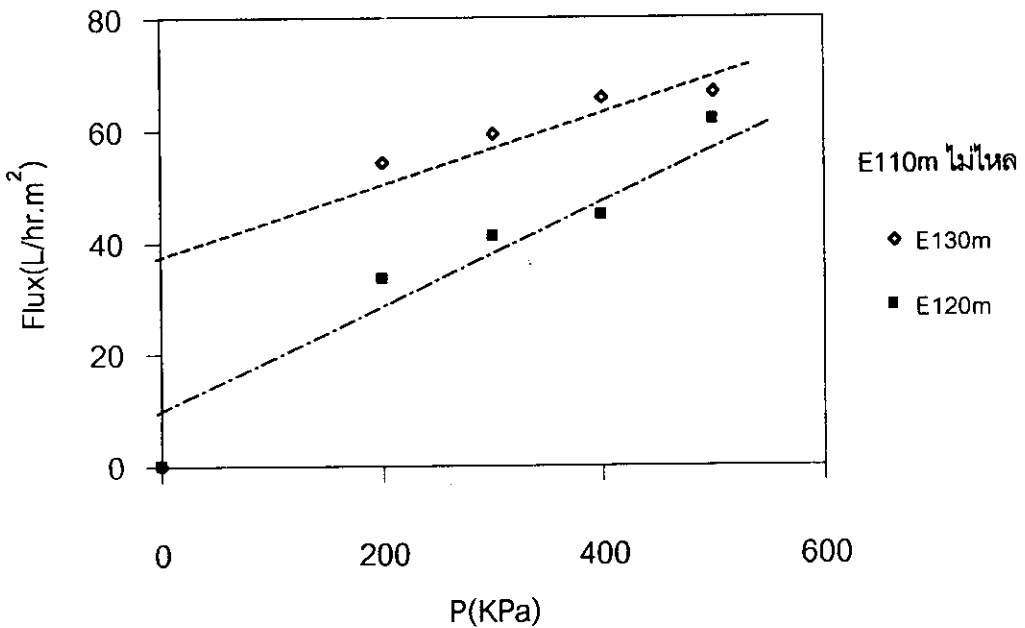


- จุดข้อมูลที่ใช้ในการกักขยายรอย 85 °C

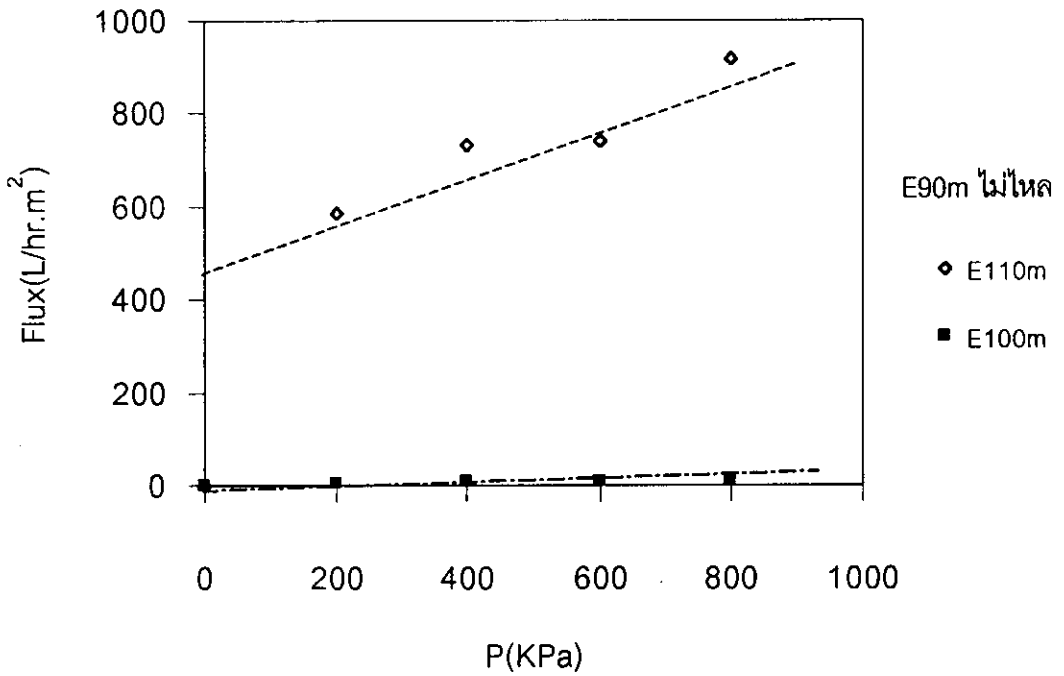


- ความเข้มข้นของ NaOH 1.25 N

- จุดข้อมูลที่ใช้ในการกักขยายรอย 75 °C



- อุณหภูมิที่ใช้ในการกักขายรอย 80 °C



- อุณหภูมิที่ใช้ในการกักขายรอย 85 °C

